微波干涉仪测量气体放电管电子密度

王玉芝 谢培良 董景星

(中国科学院上海光机所)

提要:本文用3厘米微波干涉仪,以锁相放大器作检测器;测量了微波通过气体放电管时所引起的相移。研究了在放电管中添加 N₂、He、Xe 等气体对电子密度的影响。

Measurement of electron density of a gas discharge tube with microwave interferometer

Wang Yuzhi Xie Peiliang Dong Jingxing

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Abstract: A 3 cm X-band microwave interferometer with a phase-locked amplifier as detector has been used to measure small phase changes as a microwave beam passing through the gas discharge tube.

The influences of adding N2, He, Xe in the discharge tube on electron density are studied.

-、微波干涉仪

微波沿等离子体传播时,会被等离子体 吸收、反射、散射而衰减,同时产生相移。这 些变化是与等离子体参量有关的,因此它提 供了一个诊断等离子体的好方法。我们所研 制的干涉仪如图1所示。

由于在我们的实验中,等离子体的密度 较低,振幅的衰减约为相移的 10⁻²,因此其 衰减可以忽略。因而检波器输出端信号与等 离子体所产生的相移成比例。根据等离子体 密度与相移的关系,即可得到待测等离子体 密度。



图1 3厘米微波干涉仪

1- 耿氏 (Gun) 振荡器,产生7.5~12.4 千兆周,5毫 瓦微波;2—PIN 调制器,产生1 千周方波调制; 3- 同轴波导转换;4- 隔离器;5- 可变衰减器; 6- 频率计;7- 魔T;8- 弯波导;9- 喇叭天线; 10-激光器;11- 晶体检波器;12- 锁相放大器; 13- 示波器;14-0~180° 相移器;15- 转换开关; 16- 调制电源;17- 电源

收稿日期: 1981年1月6日。

• 48 •

二、计 算

在碰撞频率 ν 满足条件 ν≤ω, ω_p<ω, 其中ω是微波频率; ω_p是等离子体频率,则 等离子体存在时所引起的相移为:

$$\Delta \phi = \int_{x=0}^{x=L} (\beta_0 - \beta_p) dx^{[1]}$$
(1)

式中L为微波穿过的路程; β_0 、 β_p 分别为真 空中及等离子体的相位常数。

$$\beta_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0} \tag{2}$$

$$\beta_{p} = \frac{2\pi}{\lambda_{0}} \left(1 - \frac{\omega_{p}^{2}}{2(\omega^{2} + \nu^{2})} \right)^{\frac{1}{2}}$$
(3)

又因 $\omega_p^2 = \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m}$,在一级近似下有:

$$\beta_{p} = \frac{2\pi}{\lambda_{0}} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{ne^{2}}{2\varepsilon_{0}m(\omega^{2} + \nu^{2})} \right) \quad (4)$$

式中 λ_0 是微波波长; ε_0 是气体真空介电常数; m、e分别为电子质量和电子电荷; n是等离子体电子密度。将(2)、(4)代入(1)则得到:

$$\Delta \phi = \left(\frac{2\pi}{\lambda_0}\right) \left(\frac{e^2}{4m\varepsilon_0}\right) \frac{1}{(\omega^2 + \nu^2)} \int_0^L n(x) dx$$
(5)

等离子体的平均电子密度可以写成:

$$\widetilde{n} = \frac{1}{L} \int_0^L n(x) dx \qquad (6)$$

将(5)代入(6)中可以得到:

$$\overline{n} = 37.63 \left(\frac{\omega^2 + \nu^2}{\omega}\right) \frac{\Delta \phi}{L} / \mathbb{I} \mathbb{R}^3 \quad (7)$$

式中的 $\Delta \phi$ 以弧度为单位,在稀薄等离子体中,满足 $\nu \ll \omega$,则(7)可以写成:

$$\bar{n} \approx 0.657 \omega \frac{\Delta \phi}{L} / \mathbb{E} \mathbb{R}^3 \tag{8}$$

在实验中取 $f=9.9 \times 10^{9}$ 赫, L=6厘米,则: $\bar{n}=6.8 \times 10^{9} \Delta \phi/{\mathbb{P}} \times^{3}$ (9)

利用锁相放大器检测,可以提高测试灵 敏度。我们以直径为6厘米,充入1大气压 N。的放电管,观测锁相放大器指示来定标, 这时候得到的相移按[2]给出的公式计算,结 果为:

$\Delta \phi_0 = 0.209 (度)$

相应可测最低的电子密度为 $n=1.36 \times 10^8$ / 厘%³。

微波在等离子体中传播的频率 ω 小于等 离子体的特征频率 ω_p 时,其振幅将由于等离 子体的吸收、反射、散射而衰减。最终使微波 完全不能透过等离子体。所以存在"截止"频 率 $\omega = \omega_p$,相应的临界电子密度为 $n_{ee} = 1.2$ ×10⁻⁸f^{2[3]}。

三、实验结果

我们利用微波干涉仪,在 CO₂ 与 CO 放 电管中,测量了 N₂、He、Xe 等气体对电子密 度的影响,同时也测量了电子密度与放电电 流及总气压的关系。

 电子密度与放电电流的关系(见图 2、图3)

由图2、3可知,无论对于CO₂、N₂、 He 混合气体放电,还是对于不同比例下的 CO₂:N₂:He 混合气体放电,电子密度均随着 放电电流的增加而增加。从图2中还可看到,



×-CO₂; O-N₂; △-He; P=9托





在同一放电电流下, He 气放电的电子密度较高。从图 3 中也还可看到, 在同一放电电流下, 在 $CO_2: N_2: He$ 的混合气体中, 含 He 的比例高, 相应的电子密度较大。

2. 电子密度与气压的关系(见图4、图
 5)





由图 4、图 5 可知,不论在 CO₂、N₂、He 纯气体放电中,还是在 CO₂、N₂、He 的混合气 体放电中,电子密度均随着总气压的升高而 降低。





×-CO₂:N₂:He=1:1:1; ○-CO₂:N₂:He=1:1:3; △-CO₂:N₂:He=1:1:8; *I*=20 毫安

因为随着气压的增加,电子与分子碰撞 机会也增加,因而电子能量损失较多,使得平 均电子能量下降^[4]。又因为电子密度可以写 成电子能量的函数:

$$n_e = \int_0^\infty f(v) dv^{[5]}$$

在平均电子能量较低时,电子密度 n_e 与电子 能量有正比关系^[6]。由于气压的增加,引起 了平均电子能量的下降,进而使电子密度减 少。

3. N₂、He、Xe 气对 CO₂ 放电管电子密 度的影响(见图 6)





○-CO₂; ■-CO₂+Xe(CO₂ 为 3 托); △-CO₂+Xe+He(CO₂+Xe 为 7 托); ×-CO₂+N₂(CO₂ 为 4 托); ▲-CO₂+N₂+He(CO₂+N₂ 为 8 托)

· 50 ·

由图 6 可知,在 CO₂ 放电管中加入 N₂、 He 或 Xe 气后,均使电子密度增加。

Xe 的电离电位比 CO₂ 和 N₂ 的 电离 电 位都低,当混合气体中存在着低电离电位的 气体时,促进了新电子的形成,增加了电导 率,因而提高了电子密度。

加入 He 气后, 使得电子密度有较大的 增加, 是因为 He 的加入, 改变了 CO₂ 放电管 中电子能量的分布, 它使只有较高能量的电



图 7 He、Xe 气对 CO 放电管电子密度的影响 ×-CO+Xe+He(CO+Xe 为 2 托); O-CO+He+Xe (CO+He 为 13 托); I=8 毫安

于数大大增加[7]。

4. He 与 Xe 对 CO 放电管电子 密 度 的 影响(见图 7)

加入 He 使 CO 放电管电子密度增加, 这 与 He 对 CO₂ 放电管电子密度的影响是一致 的。

从图 7 中可以看到,在 CO₂ 与 He 的混 合气体中,加入适量 Xe 气后,电子密度有最 佳值。这是因为,当加入少量的 Xe 气后,由 于新电子的形成,使得电子密度增加。然而 随着 Xe 气压的增加,使得 CO 放电管的平均 电子温度下降⁽⁴⁾,电子密度也随着减少。

参考文献

- [1] H. J. J. Sequin; Appl. Phys. Lett., 1973, 23, No. 6, 344.
- [2] E. Hotston, M. Seidl; J. Sci. Instrum., 1965, 42, 225.
- [3] 卢鹤跋; 《受控热核反应》, 上海科技出版社, 1962 年。
- [4] 王玉芝等; 《激光》, 1980, 7, No. 10, 17.
- [5] P. Avivi, F. Dothan Deutsch; J. Appl. Phys., 1971, 42. No. 13, 5551.
- [6] B. W. Smithers; J. Sci. Instrum., 1962, 39, 21.
- [7] M. Z. Norgozodov; IEEE J. Quant. Electr, 1971, QE-7, 510.



刺。(6)为龙右转动的机物